気相分子の内殻光電子放出における光電子波の干渉と散乱 Interference and scattering of photoelectron waves in core-level photoionizations for simple linear molecules

足立純一 ADACHI Jun-ichi

Photon Factory, Institute of Material Structural Science, Tsukuba, Ibaraki 305-0801, Japan. *e-mail: jun-ichi.adachi@kek.jp

[はじめに] 分子の光電離過程は、有限 多体系である物質と光との相互作用によ る束縛-連続遷移の典型例としてだけで はなく、速い運動の電子と遅い運動の原 子核という階層構造を持っているという 観点から、量子系の理解を深めるため重 要である。また、遷移先の連続状態が離 散状態と相互作用する可能性もあり、非 常に多彩な挙動を示す。光電離過程につ いての動的挙動の研究はいまだ少なく、 素過程として興味深い問題が多く残され ている。これは、気相分子について、通 常の光電子分光実験を行ったとしても、 分子の熱的な回転運動のため、通常は回 転平均化された情報しか得られず、詳細 な考察が困難であったためである。

近年では、分子の内殻過程の性質を活 用した同時計測法により、分子座標系光 電子角度分布 (MFPAD)の測定^[1,2]が可 能になり、回転運動による平均化を乗り 越えることができている。私たちは、SR を利用した内殻準位 MFPAD の測定を 行い、分子の光電離ダイナミクスについ て研究を行ってきている^[1]。それらの知 見はまだ充分とは言えず、MFPAD 形状 が、どのような効果により支配的な影響 を受けているのか統一的に説明できてお らず、さらに実験・理論的な研究を進め る必要がある。

内殻光電離過程の別の側面での重要性 は、物質科学における分光手法の素過程 であることである。放射光の分野では内 殻光電離過程は、分光手法に幅広く利用 されている。電子的構造のエネルギー準 位を調べるだけでなく、放出される光電 子が周囲の局所的な環境の影響を受ける ことを用いた EXAFS 法^[3] や光電子回折 法^[4] などとしても活用されている。つま り、内殻軌道からの光電子は、局所構造 のプローブとして利用できる。これまで あまり活用されていない特性として注目 している点は、光電離過程は非常に短時 間で進行するため、時間分解測定により 短時間のスナップショット情報が得られ る可能性があることである。したがって、 物質構造の情報を得るための手法と、基 礎的な光電離ダイナミクスとの関係を明 確にすることも重要である。

ここでは、 $N_2^{[5]}$ および CO 分子^[6] の 内殻 1s 準位を対象とし、MFPAD を測 定することにより、その電離ダイナミク スについて考察したことを紹介する。ま た、 C_2H_2 分子の炭素 1s 光電離過程に ついて、観測される光電子角度分布が観 測する後続過程に依存する例^[7,8] を示す。

[実験] 軟 X 線領域での高輝度の直線 偏光が得られる Photon Factory のアンジ ュレータビームライン BL2C^[9] にて実験 を行った。測定には、運動量画像同時計 測装置 CO-VIS^[10,1]を用いた。この装置 は、2 つの位置敏感型検出器を備え、運 動量画像条件を作る静電レンズ系を持つ。 内殻電離により放出される光電子と光イ オンについて、それらの時間相関とそれ ぞれの検出器上での位置から、分子解離 軸に対する光電子の角度分布を得た。

[結果および考察]

図には、CO 分子の酸素 1s および炭 素 1s 光電離過程について得られた、 MFPAD を示している。励起光の電気ベ クトル (ϵ) と分子軸とが平行である配置 についての結果であり、 $\Sigma \leftarrow \Sigma$ 遷移の MFPAD に対応している^[1]。光電子の放 出側が左側、散乱体となる原子が右側に なるように示している。このような配置 において、右水平方向が前方散乱、左方 向が後方散乱となる。

内殻光電離は局所的な 1s → kp 遷移 により説明可能である^[5-7]。図に示され ているように、50 eV 以上の運動エネル ギーにおいても、MFPAD は完全な p 波的形状を示さないことが観測された。 このような MFPAD 測定は、1 つの原 子の内殻から放出された電子が、隣接原 子により散乱されている様子を観測して いると見なすことができる。示した結果 の範囲では、前方散乱強度(右方向)は 少し増加し、その後ほぼ一定となってい るのに対し、後方散乱強度 (左方向) は 大きく減少し、再び少し増加している。 このような MFPAD の変化挙動^[6,12]は、 光電子の運動エネルギーが 90 eV 以上 の領域では、前方散乱強度がほぼ一定と なり、後方散乱強度が変動していると説 明できる。また、MFPAD の全体の形状 を決める要因について、計算機実験によ る解析^[6]を紹介する。

また、N₂分子^[5,13]とC₂H₂分子^[7,8]の内殻光電離に関するの測定結果につい

て、光電子波の干渉^[14]・非干渉の考え方 による説明を紹介する。

[参考文献および註]

- [1] A. Yagishita, K. Hosaka and J. Adachi, J. *Electron Spectrosc.* 142, 295 (2005) およびその 参考文献.
- [2] J. Ullrich, *et al.*, *Rep. Prog. Phys.* **66**, 1463 (2003); K. Ueda, *J. Phys.* **B 36**, R1 (2003) など.
- [3] "*NEXAFS Spectroscopy*", J. Stöhr (Springer-Verlag, Berlin, 1992).
- [4] C.S. Fadley, Surf. Sci. Rep. 19, 231 (1993).
- [5] 足立純一ら, 第 1 回分子科学討論会, 4C03 (2007).
- [6] 足立純一ら, 第 2 回分子科学討論会, 4C15 (2008).
- [7] J. Adachi, et al., J. Phys. B 40, F285 (2007).
- [8] T. Osipov et al., Phys. Rev. Lett. 90, 233002 (2003).
- [9] M. Watanabe *et al.*, *Nucl. Instrum. Meth.* A 467-468, 512 (2001) およびその参考文献.
- [10] K. Hosaka et al., Jpn. J. App. Phys. 45, 1841 (2006).
- [11] 穂坂綱一, 博士論文 (東京大学, 2005).
- [12] 特定の配置についての観測は、U. Becker, AIP Conf. Proc. 508, 205 (2000) に報告されてい る. その結果の解釈が、B. Zimmermann et al., Nature Phys. 4, 649 (2008) に発表されている.
- [13] X.-J. Liu et al., J. Phys. B 39, 4801 (2006); D.
 Rolles et al., Nature 437, 711 (2005)
- [14] H.D. Cohen and U. Fano, *Phys. Rev.* **150**, 30 (1966).



図 CO 分子の 1s 光電離の MFPAD. 平行遷移について,上段に酸素 1s 光電離,下段に炭素 1s 光電離の 光電子強度を極座標により示している. それぞれの測定条件における光電子の運動エネルギーの値は, 図中 に示している. 点は実験データ,実線は 10 次までの Legendre 多項式を用いてフィッティングした曲線^[1] である. フィッティングにおける A_0 係数が等しくなるように結果を規格化,つまり, $\Sigma \leftarrow \Sigma$ の遷移強度を 一定として表示している.